室温生长 MgO 底层诱导(001) 取向 FePt 薄膜的 有序化过程对 FePt 成分的依赖*

张丽娇 蔡建旺

(中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室,北京 100080) (2007年4月6日收到 2007年6月1日收到修改稿)

室温下通过磁控溅射在表面热氧化的 Si 基片上生长了 $MgO/Fe_x Pt_{100-x}$ 双层膜和 $Fe_x Pt_{100-x}$ 单层膜系列样品, Fe_x Pt_{100-x}的原子成分 x = 48—68.研究了热处理前后不同成分 FePt 薄膜的晶体结构和磁性的变化,尤其是 MgO 底层 的引入对 FePt 的晶体结构和磁性的影响.实验结果显示,直接生长在基片上的 FePt 薄膜具有较强的(111)织构,而 经过 MgO 底层诱导,所有不同成分的制备态 FePt 薄膜都表现出一定的(001)取向.热处理后,单层膜样品的强烈 (111)织构基本不变,当 Fe 和 Pt 接近等原子比即 52:48 时,薄膜最容易发生有序化,对于生长在 MgO 底层的 FePt 薄 膜,所有样品的(001)织构在退火后显著增强,有序化对 FePt 成分的依赖完全不同于单层膜的情形.当 Fe 和 Pt 原子 比为 59:41 时,生长在 MgO 底层上的 FePt 薄膜最容易有序化,表现出非常好的垂直易磁化特性,通过 MgO 底层对 FePt 薄膜微结构进而对其有序化的影响,对此进行了解释.

关键词:FeP(001)薄膜,L1₀相 PACC:7550,8140

1.引 言

近年来磁记录持续高速发展,记录密度的不断 提升要求记录介质中的磁性颗粒越来越小,以保证 其具有足够的信噪比.然而,当磁性颗粒减小到一定 尺度 室温的热扰动都可以使它的磁矩发生翻转 数 据就会被破坏 此即所谓磁记录介质的超顺磁极限. 实际上 信息记录的稳定性(如信息保留至少 10 a) 要求 磁记录介质材料必须满足 $K_{\mu}V(k_{B}T) \ge 60$, 其中 K₁ 是磁晶各向异性常数 ,V 是磁性颗粒的体 积 , k , 是玻尔兹曼常数 , T 是环境温度 . 由此可以看 出 随着 V 的不断减小,只有具有高 K 的磁性材料 才能保证未来磁记录发展的需求^[12].L1。有序相 FePt 合金由于具有极高的磁晶各向异性能($K_{\mu} \approx 7$ J/cm^3), 小的超顺磁极限颗粒尺寸($D \approx 2.8-3.3$ nm)和优异的化学稳定性^[3,4],是下一代超高密度磁 记录介质的备选材料之一,所以近年来对 L1。相 FePt 薄膜的研究已成为磁记录的一个热点,需要特 别指出的是,在同样信噪比要求下,垂直磁记录比传

统的纵向磁记录对于记录介质的厚度以及相应的磁 性颗粒的尺度要求较为宽松^{5,6]},因而垂直磁记录即 将成为工业新主流.对于 FePt 薄膜的研究,实现其 磁化易轴(*c*轴)垂直膜面,即(001)取向是有序化 FePt作为未来磁记录介质必须解决的三大难题之 一,国际上有很多研究小组近年对于 FePt 薄膜的垂 直取向问题进行了探索.

总体而言,至今大部分研究者采用加热 MgO 单 晶基片的方法外延生长有序化 FeP(001)薄膜⁷⁻¹²¹, 通常加热温度在 350 ℃以上,有的甚至高达 800 ℃, 这就对实验设备提出了很高的要求.有研究小组发 现,在加热至 120—230 ℃的 MgO 单晶基片上,通过 交替外延生长 Fe 和 Pt 单原子层的方式,可获得 (001)取向的部分有序化 FePt 薄膜^{13]};亦有研究小 组在温度为 100 ℃的单晶 MgO(001)基片上生长出 (001)取向的 FePt/Ag 多层膜,然后进行高温后退火 获得垂直取向的有序化 FePt/Ag 复合薄膜^{14]}.尽管 如此,由于 MgO 单晶基片非常昂贵,不可能应用于 大规模工业化生产,所以通过底层诱导或者别的方 式制备有序化 FeP(001)薄膜更有发展前途.较为突 出的工作是美国 Sellmyer 小组报道的快速退火方式

^{*}国家自然科学基金(批准号 50271081)资助的课题.

将非外延的 Fe/Pt 多层膜直接转变为(001) 取向的有 序化薄膜15];此外,文献[16-18]采用在室温下溅 射 MgO 底层的方法制备 FePt(001)薄膜,然后进行 高温退火得到(001)取向的有序化 FePt 薄膜.总结 所有有关有序化 FeP(001)薄膜的工作不难发现,绝 大多数研究都集中于 FePt 薄膜的成分在等原子比 附近,这是因为只有等原子比的 FePt 合金才能实现 有序度 S = 1 的理想状态,似乎等原子比更有利于 薄膜的有序化.然而,受生长条件及各种外界条件的 影响 (001) 取向 FePt 薄膜的最大有序化可能与等 原子成分相去甚远,实际上,Seki等^{19,20]}在加热至 300 ℃的 MgO 单晶基片上系统研究过 FePt 成分的变 化对于 FePt(001)和 FePt(110)薄膜有序化、磁性和 结构的影响,他们发现用此方法制备的(001)取向的 FePt 薄膜容易实现有序相的成分完全不在 Fe ,Pt 的 等原子比附近,而是在富 Pt 的成分范围,有序度最 高薄膜的 Pt 原子含量为 62%.对于室温生长的依靠 MgO 底层诱导(001) 取向的 FePt 薄膜,究竟在什么 成分下最容易实现有序化,作者尚未见报道.无论 如何,文献18,19的结果在这里未必有效,因为 两者是完全不同的物理过程.本文研究了室温下溅 射 MgO 底层的方法来制备不同成分 FePt(001) 薄膜在经历一定退火之后的结构和磁性,并将 它们与对应成分的单层 FePt 薄膜进行了对比. 我们发现通过后加热处理室温下生长于 MgO 底 层的 FePt 薄膜 其最好的垂直磁性及与之对应的 有序化发生在 Fe 原子含量为 59% 的富 Fe 薄 膜中,与单层膜及基片加热外延膜的情形完全 不一样.

2.实 验

样品的具体结构为 MgO(10 nm)/Fe_xPt_{100-x}(8 nm)/Ag(3 nm)和 Fe_xPt_{100-x}(50 nm),其中 x = 48,52,55 57 59 61 63 65 68.本实验采用表面被热氧化的 Si 基片,即把 Si 片放入 800 ℃的高温炉中并同时通 以高纯 O₂ 气进行表面氧化,在 Si 表面形成了大约 400 nm 的氧化层.这样的 Si 基片在样品退火过程中 不会产生 Si 原子对薄膜的扩散.样品 MgO/FePt/Ag 的制备过程中,先在基片上沉积一层 MgO,再沉积磁 性层 FePt,为了防止 FePt 薄层被氧化,最后沉积 3 nm 的 Ag 层作为保护层.实验中还同时制备了 x 值 对应的厚度为 50 nm 的 FePt 单层膜系列样品,选取

较厚的单层膜主要为了 Fe-Pt 成分分析的方便.对 于 FePt 单层膜 其有序化对 FePt 成分的依赖关系主 要由 Fe-Pt 的平衡相图决定^[21],与其厚度无关,不影 响系列样品的结果比较,所有样品由磁控溅射系统 在室温下制备,该系统装配有4支溅射枪,一次最多 可制备 16 片不同的样品.系统本底真空优于 3 × 10⁻⁵ Pa 溅射时高纯 Ar 气的工作气压设为 0.3 Pa. 细条状 Pt 片(纯度为 99.99%) 对称放置于 Fe 靶(纯 度为 99.99%) 上构成复合靶,通过直流溅射制备 FePt 合金薄膜. FePt 合金薄膜的化学成分由感应耦 合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)确定(偏差小 于1%),通过调整 Pt 片的数量和大小来改变 FePt 薄膜的原子成分. MgO 底层和 Ag 覆盖层分别由高 纯 MgO 靶(纯度为 99.95%)和高纯 Ag 靶(纯度为 99.99% 通过射频和直流溅射沉积.样品各层的厚 度由溅射时间控制.

制备好的样品放入真空炉中退火,退火时真空 环境优于 5×10^{-5} Pa.从已有的研究结果可以知道, FePt 薄膜形成有序相的温度与其厚度密切相关,即 厚度越薄,形成有序相所需要的退火温度也就越 高^[22].本实验中,样品 MgO/FePt/Ag 的退火温度为 600 °C,升温速率为 40 °C/min,保温时间为 30 min,而 较厚的 FePt 单层膜样品的退火温度则为 350 °C.样 品的晶体结构通过日本理学公司生产的 X 射线粉 末衍射仪测定,X 射线源采用 Cu 靶 Ka 线,扫描方 式为步进,步长为 0.02°,停留时间为 2 s.样品室温 磁特性采用美国 ADE 公司生产的高灵敏振动样品 磁强计测量.

3.实验结果及讨论

所有样品在制备态都表现为软磁性 矫顽力 H_{e} <2 kA/m.经过适当退火后,部分样品的磁性产生了 显著变化,取决于 FePt 的成分以及是否有 MgO 底 层.图 1(a)(c)(e)(g)分别为 4 个典型成分的 FePt 单层膜样品 Fe48 Pt52, Fe52 Pt48, Fe59 Pt41, Fe63 Pt57 经 过退火后的磁滞回线;图 1(b)(d)(f)(h)为对应 成分生长在 MgO 底层上的 FePt 薄膜经过退火后的 磁滞回线.从图 1(a)(c)(e)(g)可以看出,所有经 历了 350 ℃退火的单层膜 FePt 样品平行膜面磁滞回 线的剩磁比都远高于垂直膜面的剩磁比,而且垂直 膜面的磁滞回线相对于面内磁滞回线远难以实现饱 和 显然,这 4 个样品的易磁化方向更倾向于膜面

对成分的依赖.

内.从图 (a)(c)(e)(g)还可以明显看出, $Fe_{48}Pt_{52}$ 已具有较为可观的面内矫顽力, $H_e \approx 300$ kA/m; $Fe_{52}Pt_{48}$ 的面内矫顽力非常大,高达 640 kA/m;而 Fe 含量过多的 $Fe_{59}Pt_{41}$ 和 $Fe_{63}Pt_{37}$ 矫顽力都很小.对于生 长在 MgO 底层上的 FePt 薄膜,经历 600 ℃退火后, 其磁特性和上述单层膜的结果形成了鲜明的对照. 从图 (b)(d)可以看出,接近等原子比的两个样品 MgO/Fe₄₈Pt₅₂和 MgO/Fe₅₂Pt₄₈的矫顽力都不太大,其易 磁化方向从面内($Fe_{48}Pt_{52}$)开始向垂直方向($Fe_{52}Pt_{48}$)

> 1 1 0 0 -1 (a) -1 (b) 1 1 0 0 (c) -1 (d) -1 M/M_s $M/M_{\rm s}$ 1 1 0 0 (e) -1 (f) 1 1 0 0 -1 (g) (h) 800 -1600-8000 1600 -1600-8000 800 1600 外加磁场/kA·m⁻¹ 外加磁场/kA·m⁻¹

图 1 4 个典型成分的 $Fe_x Pt_{100-x}(50 \text{ nm})$ 单层膜经过 350 °C 退火样品和对应成分生长于 MgO(10 nm)底层的 $Fe_x Pt_{100-x}(8 \text{ nm})$ 薄膜经过 600 °C 退火样品的磁滞回线 实心点代表测量时外场平行于膜面 ,空心点代表测量时外场垂直于膜面 .(a)(c)(e)(g)为 $Fe_x Pt_{100-x}(50 \text{ nm})$ 单层膜 (b)(d)(f)(h)为生长于 MgO(10 nm)底层的 $Fe_x Pt_{100-x}(8 \text{ nm})$ 薄膜.(a) x = 48 (c) x = 52 (e) x = 59 (g) x = 63 (b) x = 48 (d) x = 52 (f) x = 59 (h) x = 63

我们知道,室温下 FePt 薄膜制备态通常是无序 的面心立方(fcc)结构,其磁晶各向异性能很小,表 现出软磁性.当样品经过适当的退火处理转变为面 心四方(fct)结构的有序相后,由于拥有特别大的磁 晶各向异性能,巨大的矫顽力也就随之出现.所以, 样品的矫顽力基本上反映了 FePt 薄膜中有序相的 变化程度.为了更清楚地显示样品的磁特性随其成 分而改变的细节,图 2 给出了退火处理后单层膜样 品 Fe_xPt_{100-x}的面内矫顽力 H_e//和生长于 MgO 底层 的 Fe_xPt_{100-x}薄膜的垂直矫顽力 H_{e} 随 x 的变化关

过渡,最有趣的是,拥有较高 Fe 含量的两个样品

MgO/Fe₅₉Pt₄₁和 MgO/Fe₆₃Pt₃₇表现出较好的垂直易磁

化特性(见图1(f)(h)),且其垂直矫顽力巨大,尤其 是样品MgO/Fe_{so}Pt₄,垂直方向的矫顽力达到800

kA/m,远远大于水平方向的矫顽力,垂直膜面的磁 滞回线的剩磁比接近于1,具有非常好的矩形度,上

述结果表明,MgO 底层的引入,不但改变了 FePt 的

易磁化方向 实现垂直易磁化 而且改变了其矫顽力

系.从图2可以看出,Fe_xPt_{100-x}单层膜样品经过350 ℃退火后,矫顽力 $H_{e//}$ 在 x = 52—55 附近具有较大 的值 ,x = 52 时 H_{ell}最大 ,约为 640 kA/m ;随着 x 的 减小或增加(如x = 48.57),矫顽力大幅减小,当x= 59时,H_{ell}下降约一个数量级,仅为80kA/m左 右.顺便指出 对 x = 59 的单层膜进行更高温度的 退火实验,结果发现该样品在高得多的退火温度 (550 ℃)处理后可达 600 kA/m 左右的大矫顽力.这 些实验数据清楚地表明,Fe,Pt_{100-x}单层膜在等原子 比附近的 Fe 原子含量略微富有的区域 $52 \le x \le 55$) 最有利于有序相的形成 成分偏离越多 形成有序相 所需要的退火温度也越高.这一结论可从 FePt 合金 的二元平衡相图^[21]得到理解.事实上,Ll。有序-无 序转变温度的峰值出现在等原子比附近的 Fe 原子 含量略微富有的区域,说明该成分范围的 FePt 有序 相最为稳定 比较容易实现有序化和相应的大矫顽 力.有意思的是, MgO 底层的引入大大改变了退火 后 FePt 薄膜的矫顽力和有序化对成分的关系. 从图 2可以看出,样品 MgO/Fe, Pt100-x 退火后的垂直矫顽 力峰值 $H_{c_{\parallel}} \approx 800 \text{ kA/m}$ 出现在 x = 59;随着 x 偏离 这个值越远, H_{el} 的值越小.当x = 52时,即在单层 膜 FePt 最易形成有序相的成分下 样品 MgO/Fes Ptas 的垂直矫顽力只有 240 kA/m 左右 ;当 x = 48 ,矫顽力 不足 60 kA/m,进一步的实验发现,在保持同样的退 火温度下退火时间延长 4 倍,该样品转变为垂直易 磁化,垂直矫顽力可增大至800 kA/m 左右.毫无疑 问 室温下生长于 MgO 底层的 Fe, Ptm-, 薄膜, 最容 易实现有序相的成分不在等原子比附近,而是相去 甚远的富 Fe 成分(x = 59),这个成分大大超过平衡 相图所能理解的极限,同时需要特别指出的是,在加 热的 MgO(001)单晶基片上直接生长 FePt(001)薄 膜^{19]} 最有利于有序相形成的却是富 Pt 的 Fe₃₈ Pt₆₂, 这与我们的结果恰好完全相反,下面我们对样品的 晶体结构进行分析,以说明生长条件和退火过程对 FePt 薄膜的结构进而对其磁性的影响.

我们测量了所有样品在制备态以及退火之后的 X 射线衍射谱.图 χ_a)给出 $Fe_{52}Pt_{48}$ 和 $Fe_{59}Pt_{41}$ 两个典 型单层膜样品 350 ℃退火之后的衍射谱.从图 χ_a) 可以看出,对于 $Fe_{52}Pt_{48}$,除很强的(111)衍射峰之 外,还有微弱的(110)和(200)衍射峰;而对 $Fe_{59}Pt_{41}$, 仅有较强的(111)峰.超晶格(110)峰的出现说明 $Fe_{52}Pt_{48}$ 中的确存在有序相,而 $Fe_{59}Pt_{41}$ 中根本看不到



图 2 Fe_xPt_{100-x}(50 nm)单层膜的面内矫顽力 $H_{c//}$ 和生长于 MgC(10nm)底层的 Fe_xPt_{100-x}(8 nm)薄膜的垂直矫顽力 $H_{c\perp}$ 随 x 的变化

任何超晶格衍射峰,说明有序相基本没有形成.另 外 我们将这两个样品的制备态和退火之后的(111) 峰分别作了比较,结果示于图 3(b)(c)中.从图 3 (b)(c)可以看出,退火使样品 Fe₅₀ Pt₄₁ 的(111)峰右 移较小,为0.19°,而Fe₅,Pt₄₈的(111)峰右移了0.35°. 通常 FePt(111)峰的移动,除了应力的小部分贡献 外,主要由于 FePt 的有序化使其(111)面间距减小, 所以,所有 X 射线衍射结果都显示 Fes, Pta, 形成了较 好的有序相,与矫顽力的结果完全一致,由于 FePt 的制备态为 fcc 结构 其(111) 面为原子最密面 表面 能最低,所以沉积在非晶结构的Si氧化层上的FePt 单层膜呈现(111)织构,退火后的 FePt 单层膜依然 保持(111)织构.由于 L1₀相 FePt 的 c 轴(即易磁化 轴)与(111)的夹角约为 36°,比较靠近(111)面,自然 有序化较好的样品的易磁化方向倾向于膜面内,至 于有序化不好的样品 由于强大的形状各向异性 即 退磁场)的作用,理当表现出面内易磁化.

当 MgO 底层引入后,FePt 薄膜的结构完全不同 于单层膜.图4(a)显示的是 x = 48,52,59,63 的 4 个 典型样品 MgO/Fe, Pt_{100-x}制备态的 X 射线衍射谱.从 图4(a)中虽然难以看到明显的 MgO 衍射峰,包括其 (200)峰,但 FePt 的(111)衍射峰消失了(200)峰却 可以清楚地分辨出.所以,室温下生长 MgO 底层已 经对其上生长的 FePt 取向产生了强烈的影响,导致 后者出现一定程度的(001)织构.从 FePt 的结构变 化看,MgO 底层或多或少存在(001)织构.实际上, MgO 的原子最密面为(001)面,所以从能量的角度, 它倾向于沿(001)方向生长,这也是以 MgO 为势垒 的磁隧道结比较容易获得的原因.本实验中之所以



图 3 单层膜 Fe₅₉ Pt₄₁和 Fe₅₂ Pt₄₈样品的 X 射线衍射谱 (a)单层膜 Fe₅₉ Pt₄₁和 Fe₅₂ Pt₄₈经过 350 ℃退火后的 X 射线衍 射谱 (b)和(c)分别表示这两个样品的制备态(虚线)和 350 ℃退火后(实线)FePt(111)峰位的相对移动情况

没有测量到 MgO 的衍射峰,可能由于 MgO 晶粒太 小、厚度太薄 加之其对 X 射线的散射因子较小.无 论如何 最重要的是通过 MgO 底层的诱导,FePt 层 表现出了(001 次构.图4(a)中还有一个重要的细节 需要指明,那就是 Fe_xPt_{100-x}层的(200)衍射峰峰宽 随 x 增加而增大,说明 FePt 的晶粒随 x 增加而减 小;另外,峰位随 x 增加而逐渐右移,同时峰强随 x 增加而减弱.所有这些都可以通过 Fe_xPt_{100-x}与 MgO 的晶格失配度来理解. MgO 的晶格参数为 0.420 nm,而 FePt的晶格参数在 0.388 nm 左右, x 越大, Fe_xPt_{100-x}的晶格常数越小,其衍射峰当然越往高 角度移动.同时,Fe_xPt_{100-x}层与 MgO 底层之间的 失配度变得越大,因而 FePt 的晶粒越小,衍射峰 越弱.

 $M_{gO}/Fe_x Pt_{100-x}$ 制备态的上述结构特点决定了 样品经历退火过程后的结构和相应的磁性能.图4 (b)是上述4个典型样品退火后的X射线衍射谱.从 图4(b)可以看出,所有样品中都出现了MgO(200) 峰,说明退火过程中MgO 晶粒明显长大,且所有样 品都出现了很强的FeP(002)(200)峰,而FeP(111) 峰非常弱甚至基本上看不见,说明样品在MgO 底层 的影响下都基本上是(001)取向的.最有意思的是, MgO/Fe₃₉ Pt₄₁具有特别强的(001)超晶格衍射峰,随着 FePt 成分偏离这一数值(001)峰强度减弱,当x减 小至 52,尤其x = 48时(001)衍射峰变得很微弱 了.显然,在MgO 底层引入后,相同的退火过程使



图 4 生长于 MgQ 10nm)底层上的 Fe_x Pt_{100-x}(8 nm)薄膜的 4 个 典型成分 x = 48 .52 .59 .63 样品的 X 射线衍射谱 (a)制备态, (b) 600 ℃退火后

FesoPtan有序化最好,偏离这一成分有序化就减弱.顺 便指出,对于x = 48,52的两个样品,由于有序化刚 开始 所以衍射谱的右边第一峰主要来自 FePt 的 fee 相(200),而对已经具有相当的有序相的另两个样品 (*x* = 59,63),衍射谱的右边第一峰应该主要来自 FePt的fct相(002),所以后两者的这个峰位较前两 者的对应峰位明显偏右,如果单凭 FePt 成分的变化 似乎不足以解释这个峰位的明显变化.至此 X 射线 衍射谱直接证明了 MgO/Fe, Pt100-, 样品中最容易实 现有序化的成分是富 Fe 成分 x = 59 ,与矫顽力的结 果完全一致.同时,由于其较为理想的(001)取向,所 以该样品表现非常好的垂直易磁化,最后,究竟什么 原因造成 MgO 底层引入后使 FePt 最容易实现有序 化的成分改变如此之大?我们认为 这里除了前面 所述的平衡态相图的作用外,FePt 晶粒大小的变化 是另一关键因素.FePt 的有序化过程是 Fe,Pt 两种 原子扩散、迁移从而重新占位的过程 在样品进行退 火处理导致晶粒的合并长大的过程中 晶粒边界的 原子扩散最为显著和活跃,是促进FePt有序化的一 个极为重要的额外推动力,当 FePt 层的成分从等原 子比附近向富 Fe 方向变化时,FePt 与 MgO 晶格失 配度的增加导致制备态时 FePt 晶粒减小 ,而小的 FePt 颗粒意味着更多的晶粒界面原子, 退火时产生 更为有效的原子扩散 从而极大促进有序相转变 另 外,由于制备态 MgO 晶粒很小,制备态样品因界面 晶格失配产生的应力应该不是太大,退火过程中随 着 MgO 晶粒的合并长大 ,FePt 与 MgO 的共格成长将 随之产生较大的界面应力和相应的应力能,而应力 能可以部分抵消 FePt 有序相的激活能 促进 FePt 的 有序化,所以 FePt 薄膜中 Fe 含量越高 晶格参数越 小,导致界面应力越大,越有利于 FePt 的有序化.当 然,如果 Fe 的含量过高,平衡相图中存在的制约开 始起作用,所以最终的最佳有序化成分是正反两个 机制竞争的结果.顺便指出,对于加热 MgO 单晶基 片上直接生长有序化 FePt 薄膜 Seki 等^{19]}的结果和 我们的情形刚好相反, 文献 19 没有解释为何富 Pt 成分(62%)最容易有序化.我们认为加热基片上有 序相的形成是 FePt 生长过程中表面的 Fe Pt 直接扩 散所致.由于 FePt 的晶格参数较 MgO 要小得多,当 FePt 沿(001) 方向以有序化方式生长时,也就是表面 处原子通过扩散变成交替的 Fe 单原子层和 Pt 单原 子层 富 Pt 成分下可以使部分 Pt 原子留在 Fe 原子 层内 增大 Fe 原子层内的原子间距 从而适当减小 FePt 薄膜内过大的应力,使有序化更容易,当然,此 时平衡相图的制约同样存在,所以,最终一定的富 Pt 成分是其最佳有序化的成分.需要特别强调的 是 本文中的应力与加热 MgQ(001)单晶基片上直接 生长(001)FePt 有序化薄膜中的应力对 FePt 薄膜有 序化的作用和效果完全相反.

4.结 论

本文系统研究了热处理前后生长于室温 MgO 底层的不同成分的 FePt 薄膜的晶体结构和磁性,并 与对应成分的 FePt 单层膜结果进行了对照.实验结 果表明, MgO 底层的引入使 FePt 薄膜从(111)取向 转变为(001)取向,且最容易实现有序化的成分从等 原子比附近改变到富 Fe 成分(x = 59),该样品在适 当退火后表现出非常好的垂直易磁化特性,垂直方向矫顽力高达800 kA/m,矩形比接近1.我们的结果证明,通过后加热处理室温下生长于 MgO 底层的

FePt 薄膜,是制备垂直取向有序化 FePt 薄膜的一条 有效途径,而这一方法具有一些不同于通常基片加 热原位制备取向的有序化 FePt 薄膜的特点.

- Weller D , Moser A , Folks L , Best M E , Lee W , Toney M F , Schwickert M , Thiele J U , Doerner M F 2000 *IEEE Trans* . *Magn* .
 36 10
- [2] Charap S H , Lu P L , He Y 1997 IEEE Trans. Magn. 33 978
- [3] Cebollada A, Weller D, Sticht J, Harp G R, Farrow R F C, Marks R F, Savoy R, Scott J C 1994 Phys. Rev. B 50 3419
- [4] Farrow R F C , Weller D , Marks R F , Toney M F , Cebollada A , Harp G R 1996 J. Appl. Phys. 79 5967
- [5] Jeong S, Hsu Y N, Laughlin D E, McHenry M E 2000 IEEE Trans. Magn. 36 2336
- [6] Perumal A, Ko H S, Shin S C 2003 Appl. Phys. Lett. 83 3326
- [7] Shima T, Takanashi K, Takahashi Y K, Hono K 2006 Appl. Phys. Lett. 88 63117
- [8] Zhao Z L, Chen J S, Ding J, Yi J B, Liu B H, Wang J P 2006 Appl. Phys. Lett. 88 52503
- [9] Zhang Y, Wan J, Skumryev V, Stoyanov S, Huang Y, Hadjipanayis G C, Weller D 2004 Appl. Phys. Lett. 85 5343
- [10] Shima T, Takanashi K, Takahashi Y K, Hono K 2004 Appl. Phys. Lett. 85 2571
- [11] Wei D H , Chou S C , Chin T S , Yu C C , Liou Y , Yao Y D 2005

J. Appl. Phys. 97 10N121

- [12] Weisheit M , Schultz L , Fahler S 2004 J. Appl. Phys. 95 7489
- [13] Shima T, Moriguchi T, Mitani S, Takanashi K 2002 Appl. Phys. Lett. 80 288
- [14] Li B H, Feng C, Yang T, Hwang P, Teng J, Yu G H, Zhu F W 2006 J. Appl. Phys. 99 16102
- [15] Zeng H , Yan M L , Powers N , Sellmyer D J 2002 Appl. Phys. Lett. 80 2350
- [16] Kang K, Zhang Z G, Papusoi C, Suzuki T 2004 Appl. Phys. Lett. 84 404
- [17] Zhang Z G , Kang K , Suzuki T 2003 Appl . Phys . Lett . 83 1785
- [18] Kim H J , Lee S R 2005 J. Appl. Phys. 97 10H304
- [19] Seki T , Shima T , Takanashi K , Takahashi Y , Matsubara E , Hono K 2003 Appl. Phys. Lett. 82 2461
- [20] Seki T , Shima T , Takanashi K , Takahashi Y , Matsubara E , Hono K 2004 IEEE Trans. Magn. 40 2522
- [21] Massalski T B 1990 Binary Alloy Phase Diagrams (2nd ed) (Ohio : ASM International) p1755
- [22] Takahashi Y K, Ohnuma M, Hono K 2003 J. Appl. Phys. 93 7580

Composition dependence of $L1_0$ ordering of FePt (001) thin films on MgO underlayer grown at room temperature *

Zhang Li-Jiao Cai Jian-Wang

(State Key Laboratory of Magnetism , Institute of Physics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China) (Received 6 April 2007 ; revised manuscript received 1 June 2007)

Abstract

We investigated the effect of extensive compositional change on the structure and magnetic properties of the post-annealed $\operatorname{Fe}_{x}\operatorname{Pt}_{100-x}(48 \leq x \leq 68)$ thin films with and without MgO underlayer deposited at room temperature. It was found that , during annealing , the FePt films on MgO underlayer with Fe-rich composition around 59at% exhibit much faster ordering than those with other compositions although the single layer FePt films were found to have the optimum composition for the chemical ordering of only slightly Fe-rich composition of 52at% of Fe. The film of MgO(10 nm)/Fe₅₉ Pt₄₁(8 nm) after annealing at 600 °C for 30 min showed perpendicular magnetization with coercivity about 800 kA/m and the squareness was close to 1 due to the formation of (001) oriented ordering phase. The results of FePt thin films on MgO underlayer deposited at room temperature present a striking contrast with those of FePt grown on heated MgO single crystal substrate , where the optimum composition for the ordering was around 62at% of Pt. An interpretation on the observed experimental phenomena is given in this paper.

Keywords : FeP(001) film , $L1_0$ phase PACC : 7550 , 8140

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50271081).